

《半導體製程設備》

图书基本信息

书名：《半導體製程設備》

13位ISBN编号：9789571125664

10位ISBN编号：9571125660

出版时间：2001年09月01日

出版社：五南

作者：張勁燕

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《半導體製程設備》

內容概要

半導體元件由矽土製成矽晶圓，再經數百個製程步驟，才製作出256M級的DRAM。這期間所使用的機器，主要的也不過十數種。晶圓成長爐、磊晶反應器、步進照像儀、化學氣相沉積爐、氧化和擴散高溫爐、離子植入機、乾蝕刻機、電子束蒸鍍機、濺鍍機、化學機械研磨機等。以及封裝製程設備、真空幫浦及系統洗淨機器等主要支援設備。本書對這些機器的構造和操作原理都有詳盡的敘述。

砷化鎵 – 化合物半導體製程，如金屬有機化學氣相沉積爐、分子束磊晶和銅製程使用設備、低介電常數介電製作設備以及一些2000千禧年推出的新機器，也都在本書有詳盡的敘述，次世代先進的製程設備也有一些介紹。

作者簡介

張勁燕
逢甲大學電機系副教授

書籍目錄

- 第1章 晶體成長和晶圓製作
- 第2章 磊晶沉積設備
- 第3章 微影照相設備
- 第4章 化學氣相沉積爐
- 第5章 氧化擴散高溫爐
- 第6章 離子植入機
- 第7章 乾蝕刻機
- 第8章 蒸鍍機
- 第9章 濺鍍機
- 第10章 化學機械研磨

《半導體製程設備》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com